

Фоторезист МПФ-ВЩ.

Толщина светочувствительного слоя 50мкм.

Разрешающая способность 120мкм.

Листы размером 200x150 \ 200x300 мм.

Упаковка 1 \ 5 \ 10 листов.



Описание

Фоторезист сухой пленочный МПФ-ВЩ водно-щелочного проявления, модифицированный. Применяется в производстве радиоэлектронной аппаратуры на этапах получения электропроводящих слоев требуемой конфигурации однослойных или многослойных печатных плат по негативной или позитивной технологии. Фоторезист представляет собой слой несеребряного светочувствительного материала, нанесенный на полиэтилентерефталатную пленочную основу. Поверхность светочувствительного слоя защищена полиэтиленовой пленкой, которая удаляется перед началом работ с фоторезистом.

Характеристики

Наименование показателя	Норма
Толщина светочувствительного слоя, мкм	50 [*]
Толщина полиэтилентерефталатной основы, мкм	20
Толщина защитной полиэтиленовой пленки, мкм	35
Эффективное время экспонирования от источника ДРТГ-3000 в области спектра 320-420 нм, с, не более	35
Разрешающая способность (минимальная ширина между соседними электропроводящими дорожками), мкм	120

Гальваностойкость экспонированного фоторезиста обеспечивает качественное осаждение слоя металла из электролита с рН менее 7. Химическая стойкость экспонированного фоторезиста обеспечивает обработку в растворах с рН до 10 в течение минуты и более при температуре раствора (18-25) °С.